PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

07-006360

(43)Date of publication of application: 10.01.1995

(51)Int.Cl.

G11B 5/82 G11B 5/84

(21)Application number : 05-169732

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

15.06.1993

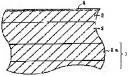
(72)Inventor: MINODA TAKATOSHI

(54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the frictional and wearing characteristics of a magnetic recording medium so that the medium is adapted to high density recording. CONSTITUTION: An Al alloy substrate is plated with nonmagnetic Ni-P to obtain a disk substrate 1. This disk substrate 1 is fixed in a texturing device and a lattice groove is formed in the surface of the substrate 1 with a buff tape, a contact roll and abrasive grains. The substrate 1 is then coated with a ferromagnetic metallic thin film 2, a carbon protective film 3 is formed on the thin film 2 by sputtering and a hard disk is finished by further coating with an org. lubricant 4. At the time of contact-start-stop action of a magnetic head, even if the gap between the head and the surface of the disk is

narrowed, hitting on a protrusion is hardly caused.



(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平7-6360

(43)公開日 平成7年(1995)1月10日

(51) Int.Cl. ⁶		織別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G11B	5/82		9196-5D		
	5/84	7.	7303 - 5D		

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 6 頁)

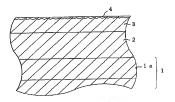
(21)出顧番号	特顧平5-169732	(71)出額人	000005821 松下電器産業株式会社		
(a.a.) storet m	TI-b = 15 (1000) A H15 H		大阪府門真市大字門真1006番地		
(22) 出顧日	平成5年(1993)6月15日				
		(72)発明者	養田 孝敏		
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器		
			産業株式会社内		
		(74) 代理人	弁理士 岡本 宜喜		
		1			

(54) 【発明の名称】 磁気記録媒体及び製造方法

(57) 【要約】

【目的】 高密度記録に対応するため、磁気記録媒体の 摩擦特性及び摩耗特性を向上させること。

【構成】 アルミ合金の基板にNiーPの非磁性体をブレーティングしてディク選板1とする。ディスク基板 1とする。ディスク基板 1とする。ディスク基板 1とする。ディスク基板 2 トロール、 一般を開いてディスク表面に格子状の溝を形成する。 たに強圧性金属薄膜2を整膜し、更にそのよびを発展した。そして有機潤滑材4を強膜し、ハードディスクを仕上げる。こうすると磁気へッドがコンタクト・スタート・ストップの動作をしたとき、ディスク表面との間隙を小さくて 1、 突起物に当たりにくくなる。



1 ----- ディスク基板

1 a ----- 非磁性支持体

2 ----強磁性金属薄膜

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ハードディスク装置に用いられる磁気記 録媒体であって、

記録媒体の表面に直線状のテクスチャー溝を形成したことを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項2】 ハードディスク装置に用いられる磁気記録媒体であって.

記録媒体の表面に格子状のテクスチャー溝を形成したことを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項3】 ハードディスク装置に用いられる磁気記 10 録媒体の製造方法であって、

ディスク基板を第1位置に固定し、

前記ディスク基板の表面にテクスチャー溝を加工するラッピング装置を押圧して前記ラッピング装置を押圧して前記ラッピング装置を送り方向 へ走査させることにより第1の直線溝を形成し、

前記ディスク基板を前記第1位置より一定角度回転した 第2位置に固定し、

前記ラッピング装置を送り方向へ走査させることにより 第2の直線溝を形成することを特徴とする磁気記録媒体 の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はハードディスク装置に用いられる磁気記録媒体及びその製造方法に関わり、特に 磁気へッドに対して耐摩擦性及び耐摩耗性を向上した磁 気記録媒体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】磁気電線基度 (ハードディスク装置) では、情報の高密度記録に伴い副原料性及び副摩擦性を向上させることが要求されている。図1はハードディスク の代表的な構造を示す断面図である。最下部に示す基板には例えばアルミ合金基板、ガラス基板、又はプラスチック基板が用いられる。現在は主にアルミ基板が用いられる。基板上に非磁性支持体であるNiーPを10~20μmの厚みでプレーディングし、その後ポリッシュ加工を施してディスク基板を形成する。

[0003] 従来の施気紅線媒体 (ハードディスク)の 製造方法では、非磁性支持体をブレーティングしたディ スク基板に対してテクスチャー加工を行い、円周方向に 浅い溝を形成する。図2は従来のテクスチャー加工を施 した状態を示すディスク基板の平面図である。テクスチャー加工の目的はディスクの円周方向に磁気風方性を付 け、しかもその表面を担くすることにより磁気へッドと ハードディスクとの接触面積を減らし、摩擦性及び摩耗 特性と吸着特性を失々向上させることにある。

【0004】テクスチャー加工の方法として、研磨低粒 をテープに付署させたラッピングテープを用いてディス ク基板をラッピングする方法、又はアルミナA1。〇、 やダイヤモンド等の遊離低粒をパフテープに垂らしなが らディスク基板をラッピングする方法がある。このとを 50 低粒の大きさ又はディスク基板の回転速度等の条件を変化させると、ディスク表面の組さも異なったものとなる。又このような条件により製造されたハードディスクにおいて、コンタクト・スケート・ストップ(以下CCSという)方式で磁気へッド(以下ッドという)を動作させることからディスク表面はヘッドの浮上量との関係で適切な粗さが求められる。

【0005】例えばディスク表面の相合が大きすぎると大きな突起物(ばり)が突発的に発生する。この突起成分がヘッドの浮上量より大きい場合、ヘッドはその突起物に衝突し、ヘッドクラッシュを発生させる。このためティスタ表面の相きはより動一て観常な変足成分がない状態に仕上げなければならない。現状のハードディスクでは、ヘッド浮上量が0.15 μ m の場合、ディスク表面の相とはおりを8 n m 程度である。

【0006】このように作成されたディスク基板に対し、強磁性金属薄膜(Co→Cr→Ta)を30~50 nm、カーポン保護膜を20~30 nm、スパッタリング法で形成する。最後に潤滑油 (パーフルオロアルキル2 ポリエーテル等)をディッピング法やスピンコート法により1~2 nmコーテンィグする。この場合ハードディスクの最終表面の粗さはディスク基板の粗さとほぼ対応したものとなる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】浮上型磁気ヘッドを用いたハードディスク装置の場合、起動停止方式として現在CSS方式が主として用いられている。CSS方式ではハードディスクの起動停止時にヘッドが磁気記録媒体面上で摺動する。このためディスク表面に大きな突起物30 があると、磁気記録媒体に損傷が生じるという問題点があった。

【0008】 又最近では情報の高密度記録化に伴い、ヘッド材料もフェライト(モノシリクヘッド)からチン 酸カルシウム(コンポジット・ッド)やアルチック(海 膜ヘッド)に移行している。アルチックはフェライトよ りも3倍程度硬く、ヘッドが底に磁気配録媒体で掲動す ると、磁気記録媒体表面に磨耗が生じる。又これに伴い ヘッドと磁気記録媒体間の提胎面積がより増加して摩耗 係数が上昇するというトラブルがあった。又極端な場合 は磁気記録媒体の磁性層の破壊(クラッシュ)か発生す るという事故もある。

30と、アルスの公司、東なる情報の高密度記録化に伴い、ハードディスクの磁性層とヘッドとのスペーシングをより小さくする必要がある。このためディスク基板の表面粗さはより小さくしなければならない。しかレハードディスク表面に接触しており、ディスク表面相さがかさくなるとヘッドが満層潜ル及び大気中の水蒸気の滞在により吸着現象(張り付き現象)を起こすという問題があった。この状態でハードディスク装置が動作を開始すると、ヘッドが張りハードディスク装置が動作を開始すると、ヘッドが張りハードディスク装置が動作を開始すると、ヘッドが張りハードディスク装置が動作を開始すると、ヘッドが張りハードディスク装置が動作を開始すると、ヘッドが張りハードディスク装置が動作を開始すると、ヘッドが張りハードディスク装置が動作を開始すると、ヘッドが張り

いたままとなり、ハードディスクが回転しなくなる。こ のようにディスク表面の摩擦及び摩耗特性と吸着特性を 失々改善するためには、ハードディスクの表面形状が大 きく関与していることがわかる。

[0010] 本発明はこのような従来の問題点に確めて なされたものであって、高密度記録のために確気ヘッド の浮上量を少なくしたり、総欠ヘッド材料に高硬度のも のを使用しても、耐撃療性及び耐摩耗性や、吸着特性に 優れた磁気記録媒体及びその製造方法を実現することを 目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】本順の請求項1の発明は ハードディスク装置に用いられる磁気記録媒体であっ て、記録媒体の表面に直線状のテクスチャー溝を形成し たことを特徴とするものである。

【0012】本願の請求項2の発明はハードディスク装 置に用いられる磁気記録媒体であって、記録媒体の表面 に格子状のテクスチャー溝を形成したことを特徴とする ものである。

[0013] 本願の請求項3の発明はハードディスク装 20 歴に用いられる磁気記録媒体の製造方法であって、ディスク基板を第1位置に固定し、ディスク基板の表面にテクスチャー溝を加工するラッピング装置を押圧してラッピング装置を送り方向へ走査させることにより第1の直 転した第2位置に固定し、ラッピング装置を送り方向へ走査させることにより第2の直線清を形成することを特 機とするものである。

[0014]

【作用】このような特徴を有する本発明によれば、ディスタ基板に直線状又は格子状のテクスチャー溝を設けることにより、テクスチャーの突起師の分布が同心円状にならなくなる。このため磁気へッドがコンタクト・スタート・ストップの動作モードで磁気記録媒体を走査した場合、突起物に接近又は接触する機会が単発的となる。又テクスチャー溝の信が成分で繁耗しても、磁気へッドの走査方向からみ見て解耗的が分散してテクスチャー溝にたまる。このため記録媒体の摩耗を最小限に抑えることができ、磁気配録媒体の停耗を最小限に抑えることができ、磁気配録媒体の信頼性が向上する。又第1、第2の位置で夫々テクスチャー加工することにより40テクスチャー溝の交差角を任意につけることができるので、交発角の低らのきがなくなる。

[0015]

【実施例】本発明の一実施例における磁気記録媒体及び その製造方法について図面を参照しつつ説明する。図1 は本発明の一実施例における磁気記録媒体の構造を示す 一部切欠き断面図である。本図においでディスク基板1 はアルミ合金の基板に非磁性支持体1 a としてNi-P を10~20μmプレーティングし、後述するテクスチャー加工を施したディスタ基板である。 【0016】ディスク基板10上に場感性金属薄膜2と してCo-Cr-Taを45nm塗膜する。次に強感性 金属薄膜2の表面に、カーボン保護膜3としてカーボン 金盤膜する。これらの層はDCマグネトロンスパッタ法 で形成される。最後にカーボン保護膜3の表面に、潤滑 層としてパーフルオロアルキルポリエーテル等をディ ッピング法で1.5nm塗膜する。

【0017】次にディスク基板1のテクスチャー作成方法について図4〜図6を参照しつつ説明する。図4はテクスチャー作成方法の第1段階を示した正面図、図5は第2段階を示した正面図、図6はテクスチャー作成装置の構造を示す側面図である。

【0018】まず第1段階としてNiーPがブレーティングされたディスク基板1を平均推さ1mmになるようボリッシング加工を施す。そしてこのディスク基板1をテクスチャー作成装置に固定する。次にコンタクトロール5に例えば100mm幅のパフテープ6を回答する。次に延粒供給プスルブよりダイヤモンド混粒をパフテープ6に噴射する。このとき図6にデす位置からコンタクトロール5をディスク基板1を回転しない状態にロックし、コンタクトロール5を回転させる。次にコンタクトロールランのでは1を回転しない状態にロックし、コンタクトロール「8程度の速度で図6の矢印方向に沿って5~30秒間程度往後運動させる。こうすると互いに平行な直線構84がアンス多振的に形成される。

【0019】尚、砥粒としてダイヤモンド砥粒を用いたが、アルミナや二酸化珪素でもよい。又ここでは極性 結ノズル7から遊離砥粒を噴射させたが、 概粒を予め塗 布したラッピングテープを用いて溝を形成しても良い。 このようにテクスチャー加工すると、砥粒の大きさ(粒 径分布)、圧力、加工時間によって任意の表面組さが実 現できる。

【0020】 次に第2段階のテクスチャー作成方法について説明する。図5に示すようにディスク基板1を特定の角度に回転させて再び固定する。次に第1段階の作成工程と同様、バフテープ6を回巻したコンタクトロール5を回転させ、低粒供給ノズル7からダイヤモン・低粒を1に押圧し、第1段階と同一条件で溝8bを形成する。【0021】図3はこのような製造方法でテクスを基板1に押圧し、第1段階と同一条件で溝8bを形成する。【0021】図3はこのような製造方法でテクステャー作成されたディスク基板1の平面図である。図3の拡大第に示すように第1段階で形成した直線上の溝8aと技能に示すように第1段階で形成した直線上の溝8aと技能に示すように第1段階で形成した直線上の溝8aと技能の溝8bの角度を交差角と呼ぶ。図4、図5に示すな方な方法で加工すると、交差角は0~90°の範囲で任意に設定できる。

【0022】さてディスク基板1を回転させ、抵粒付の バフテープ又はラッピングテープを半径方向に揺動させ る従来の加工方法では、交差角度がディスク基板1の各 50 部分で一定していなかった。しかし木実施例の方法では 図3に示すようにディスク基板1の全面に渡って一定の

* し、ディスク基板1に対して数種類のテクスチャー加工 を行った。この結果を表1に示す。

【0023】交差角と表面粗さを2つのパラメータと * 【表1】

交差角を任意の値で実現することができる。

	テクスチャー 形状のタイプ	表面粗さ Ra	交差角	2 万回後の 摩擦係数
実施例1	格子タイプ	6 n m	9 0°	0. 27
実施例2	格子タイプ	4 n m	70°	0. 28
実施例3	格子タイプ	5 n m	50°	0.30
実施例4	格子タイプ	4 n m	50°	0. 29
実施例5	格子タイプ	5 n m	20°	0.34
実施例6	格子タイプ	4 n m	20°	0.36
実施例7	格子タイプ	5 n m	10°	0.35
実施例8	格子タイプ	4 n m	5°	0.37
比較例1	同心円タイプ	6 n m	0°	0. 51
比較例2	同心円タイプ	4 n m	0°	0.58
比較例3	同心円タイプ	4 n m	2 0°	0.49

ここでは交差角を5~90°、表面粗さ(平均)で4n m~6nmで変化させ、ハードディスクとヘッドとの信 頼性試験を行った。又本実施例との比較として従来方法 による結果を表の下部に示す。

【0024】信頼性試験の条件として磁気ヘッドを薄膜 ヘッドとし、9.5gの荷重を与え、浮上量を0.10 30 μmとした。又図4、5に示すテクスチャー作成装置に おいて、コンタクトロール5をディスク基板1の中心よ り21.0mmのところから外周に向かって10秒間で ヘッドを立上がらさせ、更に10秒経過してからヘッド を下げた。このようなCSS試験を2万回まで行い、そ のときの摩擦係数を歪みゲージを用いて測定した。尚、 表面粗さはタリステップ装置を用い、0.1μmの触針 で測定している。

【0025】表1に示すように従来の同心円タイプのテ クスチャー形状に対し、本実施例の格子タイプのテクス 40 チャー形状では、CSS試験2万回後の摩擦係数が小さ い値に止まっていることがわかる。例えば実施例6と比 較例3を比較すると、ディスク基板1の表面粗さ,交差 角が夫々同一であっても、格子状タイプのテクスチャー 形状の方が優れていることがわかる。又比較例1,2に 示すように従来の同心円状タイプのテクスチャーでは、 高密度記録に伴いヘッドの浮上量を少なくするためディ スク基板の表面粗さを小さくする。こうすると試験後の 塵擦係数がやや増加することがわかる。

すように、表面粗さが小さくても格子状タイプのテクス チャーであれば、試験後の摩擦係数が信頼性が保てる程 度の範囲に小さく収まっていることがわかる。

【0027】従来の同心円状タイプのテクスチャーであ れば、同心円上にテクスチャーのばり成分がディスク基 板1に発生し易い。このばり成分でヘッドが摺動すると **摩耗が生じ、且つ接触面積が増加し、摩擦係数が上昇す** る。従ってこの状態で動作を続けると最終的に磁性層の 破壊にまで至ってしまう。しかし本実施例の格子状タイ プのテクスチャーでは、ばりが同心円上に発生しない。 仮にばりがあったとしてもヘッドとハードディスクが点 接触であり、ハードディスクの摩耗も最小限に抑えるこ とができる。又表面粗さが小さくなるとヘッドとの接触 面積が大きくなるが、格子状タイプのテクスチャーでは 点接触であるため接触而積が途中で増加せず、摩擦係数 の上昇を抑えることができる。

【0028】次にディスク基板1の表面粗さが小さくな ると、ヘッドとハードディスクとの微小隙間に潤滑油及 び大気中の水蒸気が毛細管現象で夫々凝縮され、ヘッド 吸着現象が生じる。このような状態の加速試験として、 例えば65°、80%RH、24時間の高温高湿状態で 信頼性試験を行なった。この結果を表2に示す。

【0029】表2に示すように交差角を5~90°、表 面粗さ (平均) を4 n m としてテクスチャー加工を行っ た。又比較例としてラッピングテープを用いて同心円状 【0026】これに対して表1の実施例2、4、6に示 50 のテクスチャー加工を行った。CSS試験の前後におけ

る静止摩擦係数の差をとると、表2の右側に示すような *【表2】 状態となる。

	-			
	テクスチャー 形状のタイプ	表面粗さ Ra	交差角	環境履歴前後 の静止摩擦 係数の差
実施例2	格子タイプ	4 n m	7 0°	0.03
実施例4	格子タイプ	4 n m	50°	0.06
実施例 6	格子タイプ	4 nm	20°	0.02
実施例7	格子タイプ	4 n m	10°	0.05
比較例2	同心円タイプ	4 n m	0°	0.18
比較例3	同心円タイプ	4 nm	20°	0.08

表面組さ4nmの格子状のテクスチャーと、同心円状の テクスチャーで比較したところ、格子状のテクスチャー は摩擦係数に大きな変化がみられず、同心円状のディス クでは若干の増加がみられる。このような結果からも格 子状テクスチャーの効果が裏付けられる。尚、ヘッドの 20 浮上量は0.075 μmで、安定に浮上していることが実験 で確認された。

【0030】尚、本実施例では一定の交差角が形成され るよう、テクスチャー溝を2種類設けたが、直線状のテ クスチャー遺だけでもよい。又テクスチャー加工する際 の砥粒を小さくすることにより、格子の単位面積当たり の数を更に殖やすことができる。こうするとディスク表 面と磁気ヘッドとの接触面積が減少し、摩擦係数の上昇 を抑えることができる。

[0 0 3 1]

【発明の効果】以上詳細に説明したように本発明によれ ば、ディスク基板の表面形状であるテクスチャー溝を直 線状又は格子状に形成する。特に格子状の場合、同心円 状のテクスチャー溝に比べ一定の任意の交差角を付ける ことができ、更に表面粗さを小さくしても磁気ヘッドの 安定した接触状態と浮上状態が得られる。更に磁気ヘッ ドの吸着特性にも若干の効果が見られた。更に磁気ヘッ ドに硬い材料を使用しても、今後の低浮上化に伴い表面 粗さの低下しても、テクスチャー溝によって安定した情 報の記録再生特性が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施例及び従来例における磁気記録媒体の要 部構成を示す拡大断面図である。

8

【図2】 従来例の磁気記録媒体におけるテクスチャー構 告を示す平面図である。

【図3】本実施例の磁気記録媒体におけるテクスチャー 構造を示す平面図である。

【図4】本実施例の磁気記録媒体の製造方法に用いられ るテクスチャー作成装置(第1段階)の構造を示す平面 図である。

【図5】本実施例の磁気記録媒体の製造方法に用いられ るテクスチャー作成装置 (第2段階) の構造を示す平面 図である。

【図6】本実施例の磁気記録媒体の製造方法に用いられ 30 ろテクスチャー作成装置の構造を示す側面図である。

【符号の説明】

- 1 ディスク基板
- 1 a 非磁性支持体 2 強磁性金属薄膜
- 3 カーボン保護膜
- 4 潤滑層
- 5 コンタクトロール
- 6 バフテープ
- 7 砥粒供給ノズル
- 40 8a, 8b 溝

